トピックス

X線回折法によるSi(lll)表面上の  $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$  – Ag構造の解析

高橋敏男,中谷信一郎,岡本直子,石川哲也\*',菊田惺志\*'

東大物性研,東大工学部\*)

Structure Analysis of Si(III) $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$  – Ag Surface by X–Ray Diffraction

Toshio Takahashi,Shinichiro Nakatani, Naoko Okamoto, Tetsuya Ishikawa\*) and Seishi Kikuta\*)

Institute for Solid State Physics, University of Tokyo

\*) Dept.Applied Physics, Faculty of Engineering, University of Tokyo

The surface structure of  $Si(III)\sqrt{3} \times \sqrt{3}$  -Ag was analyzed by a new X-Ray diffraction method, in which the diffracted intensities of the fractional-oder and integral-oder spots were measured along the rods. Honeycomb models with two Ag atoms in the unit cell were ruled out. A new model for the Ag structure was proposed, in which triangles made of Ag atoms are chained in a honeycomb arrangement. The adsorption site of the Ag atoms with respect to the unreconstructed Si crystal was obtained from the intensity change along the integral-oder rods. The adosrption site is consistent with the STM images if the observed protrusions are interpreted as the cluster of Ag atoms.

1. はじめに

超高真空中において, Si(lll)清浄表面にAgを1 原子層程度吸着し,適当に熱処理すると( $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ ) R30°構造と呼ばれる超構造(長周期構造) ができる。この構造は、ほとんど全ての表面解析 法<sup>1-12)</sup>で研究されているにもかかわらず、未だ に決定されておらず、表面の研究者を悩ましてい るものの1つである。そもそも、Agがユニット・ セル中でどのような配列をとるかについても意見 が分かれ,それぞれ,honeycombモデル,trimer モデルと呼ばれる図1(a),(b)に示すような2つの 原子配列モデルが提唱されていた。

最近, STM (走査トンネル顕微法)を用いて, 図 2<sup>13)</sup>のようなハニカム状の像が米国IBMの 2 つのグループ<sup>13-15)</sup>で独立にほぼ同時に観測され, Physical Review Letters 誌の同じ号に並んで 掲載された。しかし, 2つのグループの結論は異 なり, 一方のグループ<sup>14,15)</sup>は, 図1(a)のように,

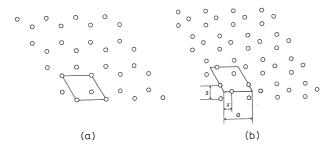


Fig. 1. Illustration of the atomic arrangements of a honeycomb model(a)and a trimer model (b). Unit cells of the  $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$  structure are shown by solid lines. In the trimer model, clusters of Ag atoms form triangles. The length of the  $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$  unit cell, a is 6.65 A. A parameter x is used to measure the size of the triangle.

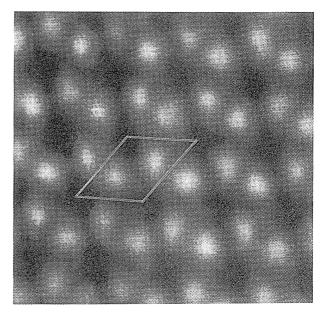
Ag 原子がハニカム状に配列していると主張した。 他方のグループ<sup>13)</sup>は、ハニカム状に配列してい るのは、Si 原子であり、Ag 原子はその下に埋もれ ていて、図1(b)のような原子配列をとると主張し、 ますます論争に拍車をかけた。

その後, 我々は, X線回折法により, 図1(a)の モデルは, 完全に否定できることを示し, さらに, 図1(b)を修正した新たなモデルを提唱した。現在, まだ, 全ての原子位置を決定できた訳ではないが, 本稿では, 部分的に解析できた結果を紹介する。

2.  $(\sqrt{3} \times \sqrt{3})$  R30° 構造

Siはダイヤモンド型の結晶構造をもつので、その(111)表面は、図3に示すような原子配列をしている。(111)表面の第1層Si原子(大きい白丸)は、周期的に配列し、それらの原子のつくる2次元格子のユニット・セルは、図の破線のようにとることができる。これと同じ2次元周期性をもつ表面構造を表面結晶学では、1×1構造と呼ぶ。

表面にできる超構造は、このユニット・セルを 単位に指数がつけられる。 ( $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ ) R30° 構造は、図の実線で示すように、ユニット・セル の1辺の長さがそれぞれ1×1構造の $\sqrt{3}$ 倍で、1 xl構造に対して30度回転した構造である。以後簡 単のため $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ 構造と表示することにする。



- Fig. 2.<sup>13)</sup> An STM topograph obtained for -1 Vbais on the sample. Lines show the  $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$  unit cell. The small distortions of the unit cell arise from thermal drift.
  - 0 1st layer
  - 2nd layer

° 0 ° 0 • O 0  $\circ$ 0  $\cap$ o  $\cap$ 0 0  $\cap$ 0  $\cap$  $\cap$ 0  $\cap$  $\cap$ 0 0 0 0  $\cap$ Ο 0  $\cap$ 0  $\cap$ 0 Ο C 0 0 0  $\cap$  $\cap$  $\cap$  $\cap$ 

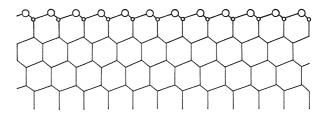


Fig. 3. Top and side views of the unreconstructed Si(III) surface. Broken lines show the  $1 \times 1$  unit cell. The  $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$  unit cell is shown by solid lines.

この図からも分かるように、 $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ 構造は、 2次元六方格子では、非常に基本的な超構造であ

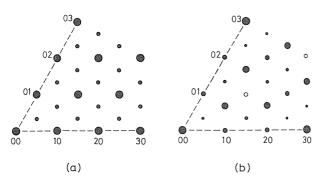


Fig. 4.<sup>16)</sup> The intensity distributions of the diffractions patterns calculated for the arragements shown in Fig.I(a)and (b). The area of the circle is proportional to the diffracted intensity. In(b), the value of x/a is assumed to be 4/9, and open circles mean the zero intensities.

# ると言える。

 $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ 構造は、 $1 \times 1$ 構造の3倍の面積をも つので、 $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ ユニット・セル当たり、3個 のAg原子をもつと被覆率が1になる。図1(a)、 (b)は、それぞれユニット・セルあたり2、3個の Ag原子を含むので、(a)のhoneycombモデルで は、Agの被覆率は2/3、(b)のtrimer モデルでは 1となる。

### 3. 表面構造の決定

この表面構造を決めるに当たっては,最終的に は,各原子の座標を与えるわけであるが,その前 段階として,

- 1) Ag 原子はどのうよな原子配列をとるのか。
- Ag 原子のSi基板結晶に対する吸着位置は どこなのか。
- 3)表面のSi原子は、どの程度変位しているのか。バルクの位置を基準に少し変位した程度となのか、あるいは、バルクの位置から全くかけ離れた位置に再配列しているのか。
- 4)表面の第1層を占める原子は, Ag か,あ るいはSi か。Ag 原子は, Si 原子とどのように結合しているのか。

を決める必要がある。

3.1 Ag原子はどのような原子配列をとるのか。

Ag の $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ 構造のユニット・セルは小さ く,しかも,図1(a),(b)の2つのモデルは,Ag 原子の被覆率は,2対3と大きく異なるので,そ の構造は,容易に決定できるように思われる。し かし,実際にはほとんど全ての表面解析法で研究 されているにもかかわらず,その構造は決定され ていない。

表面の原子密度は、オージェ電子収量の測定, イオン散乱法などで行われるが、表面構造がある 程度分からないと決定しにくいという側面がかあ る。例えば、4)とも関係するが,Ag 原子が表 面第1層にはなく,Si 原子層の下に埋もれている 場合や,Ag 原子が島状構造をとる場合などには, Ag原子の密度の決定には、注意が必要になって くる。このため、これまでの報告を見ても、実験 グループにより、異なる結果が報じられている。

一方,図1(a),(b)の原子配列は,結晶で言えば, たとえば,bccとfccの違いにも匹敵し,回折法で 容易に区別できそうなものである。しかし,表面 付近のSi原子もバルクの位置からかなりずれて いる場合には,Si原子からの回折の寄与も加わり, 2つのモデルの判別は、必ずしも容易ではない。 実際,電子回折法ですでに解析が行われているが, はっきりした結論には至っていなかった。

X線の場合には、散乱強度は、原子番号のほぼ 2乗に比例するので、Ag(原子番号47)とSi(原 子番号14)を区別するのは容易である。たとえ、 表面のSi原子がかなり変位していても図1(a)、 (b)の区別を誤る可能性は殆どない。以下、(a)のモ デルは完全に除外できことを示し、さらに、(b)の モデルを修正した新しいモデルが実験結果をもっ ともよく説明できることを述べる。

X線回折法は、今の場合、ごく粗い近似では、 Si 基板は、X線に対して透明であり、X線は、 「Agの2次元格子のみにより回折される」と考 えて差し支えない。その場合には、図1(a)、(b)の ような2次元格子からの回折強度分布は、どのよ

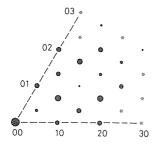


Fig. 5 <sup>17)</sup> The intensity distributions of the diffractions patterns observed for the  $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ structure. The intesnities were obtained by averaging the intensities along the rods.

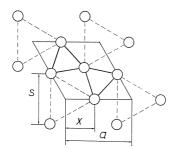


Fig. 6. A modified trimer model of the √3×√3Ag structure. Ag atoms move outwards in the Fig. 1 (b), and makes triangles at different positions. Ag atoms have four nearest -neighbor Ag atoms. The distance between the nearest-neighbour Ag atoms is about 3.4 A, which corresponds to the van der Waals distance of Ag.

うになるかを調べれば良いことになる。これら2 つ構造による回折強度分布は,非常に簡単な計算 から,図4<sup>16)</sup>(a),(b)のようになる。2つの回折 強度分布の特徴は,(a)では,2通りの強度しか存 在しないのに対し,(b)では,凝集している三角形 の大きさにもよるが,さまざまな強度が存在する ことである(白丸は,回折強度がゼロであること を表す)。

図5<sup>17)</sup>は、実験で得られた回折強度分布である(\*印は、測定していない点を表す)。さまざまな強度があり、図4(a)の強度分布とは全く異なる。 例えば、(11)、(22)スポットのように、回折強度がほとんどゼロになるスポットもある。このようなことは、図1(a)のモデルでは、まったく起こり 得ず、(a)のモデルは、否定できる。結晶の場合で

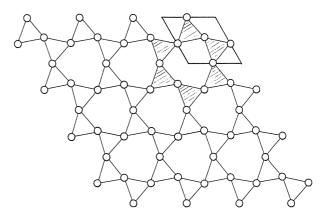


Fig. 7. A large scale view of the honeycombly chained triangle (HCT) model.

言えば, 消滅則から結晶構造をある程度判別でき るのと同じである。この結論は, 今の場合, たと えSi 原子がかなり再配列していても変わらない。

図1(b)のような原子配列では、強度分布は正三 角形の大きさに強く依存する。図5の実験結果を 最も良く説明する三角形の大きさをfitting 法に より求めると, x/aは、約4/9であった。その時の 原子配列は、図6のようになる。ここで, aは  $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ 構造のユニット・セルの1辺の長さを 表し, 6.65Aである。x は、三角形の中心から測っ た原子までの距離を意味する。

図1(b)の trimerモデルでは, x/aは1/3より小 さく,対称の中心に向かって3つの原子が凝集す るのに対し,図6では, x/aは1/3より大きいので, 3つの原子は外側に広がり,破線で示された大き な三角形状に配列する。このため、こんどは、広 がった原子どうしで新たな三角形(太い実線)を 作る。図7は,見やすくするために、多くのユニッ ト・セルを書いたものである。新たにできた三角 形は、互いにつながるようにしてハニカム構造を とるので,我々は、これをHCT(honeycombly chained triangle)モデルと呼ぶことにした。1 つのAg 原子は、4つの最近接原子をもつので, 図1(b)のtrimerモデルとは、全く異なる原子配 列であることに注意しなければならない。

このモデルでは, Ag-Agの最近接距離は,約3. 4Aである。これは, Agのvan der Waals 距離に

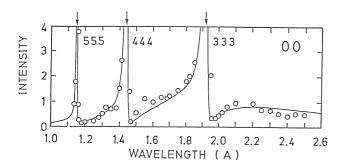


Fig. 8.<sup>16)</sup> The intensity change of the(00)spot as a function of the wavelength of X-rays, which corresponds to the I-V curve in low energy electron diffraction.

良く一致している。

## 3.2 Si基板結晶を基準にした吸着位置はどこか。

ここでは, Si 基板結晶は,図3に示したように 再配列していないと仮定し,そのようなSi 結晶 に対する吸着位置をまず求める。そのあとで,表 面付近のSi 原子がどの程度変位しているかを考 察する。このようなことができるのは, Ag の原 子番号がSi の原子番号に比べてかなり大きいか らである。

3.1で求められたAg 原子層とSi基板結晶と の位置関係は、次のような原理により求められる。 Ag 原子層で回折されたX線の波と, Si 基板結晶 全体で回折されX線の波は、干渉するので、互い の位置関係により、ある場合には、2つのX線波 は強め合う干渉を起こし、ある場合には弱め合う 干渉を起こす。従って、2つの波の干渉の仕方か ら、Ag 原子層とSi 基板結晶との位置関係を求め ることができる<sup>17.18)</sup>。

図 8<sup>16</sup>)は、入射角と射出角の等しい対称反射 の配置で、入射X線の波長を変えて回折強度の変 化を測定したものである。Siの333、444、555な どのブラッグ反射に対応する位置で鋭いピークに なる。図は、それらのピーク間の強度分布を示し たものである。この領域では、Si 基板結晶全体で 回折された波の振幅と、Agl原子層で回折された 波の振幅が同程度の大きさになり、2つの波の干

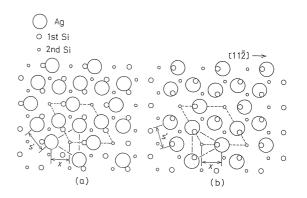


Fig. 9.<sup>17)</sup> The adsorption site of the Ag atoms with respect to the unreconstructed Si crystal. The good fits were obtained only for the sites(a) and(b). The spacing between the Ag layer and the unreconstructed Si Ist layer is  $2.9\pm0.1$ A for the both models. Preliminary analysis indicates that a Si layer lies below the Ag layer by about 0.9 A, and that the surface is terminated by the Ag layer.

## 渉効果を顕著に捕らえることができる。

回折強度は、各ブラッグ反射のピークの両側で 非対称な変化をしている。吸着位置が少し変わる と、干渉の仕方が変わり、それにともなってこの 非対称なプロファイルは左右逆になることもある。 実験結果をもっともよく説明できる吸着位置を fitting 法により求めると、Ag 原子は、再配列し ていないSi 第1原子層の上2.9±0.1Aの位置に あることが分かった。

同様な測定を入射角と射出角の異なる非対称な 配置で行うと,面内の吸着位置も決定できる。面 内の吸着位置は,対称性から6通りの可能性があ るが,いくつかの実験結果の解析から図9(a), (b)<sup>17)</sup>に示した2つの位置だけが可能性のあるこ と分かった。一致の程度は,(a)の吸着位置の方が (b)の位置より若干良かった。その他の4通りの吸 着位置では,一致の程度は全く悪かった。

### 3.3 表面のSi原子は,どの程度変位しているか。

3.2では、表面付近のSi 原子の変位は無視して解析した。もし、表面付近のSi 原子がバルク

Fig. 10.<sup>16)</sup> The intensity change of the  $(2/3 \ 2/3)$  spot as function of the wavelength of X – rays. From the period of the intensity oscillation, we can say that the Si atoms on the lst and 2 nd layers shown in Fig. 9 are displaced considerlably from the bulk positions.

の位置からずれていれば、それらの原子で回折し た波と、Ag 原子層で回折した波の干渉効果が回 折強度の測定に観測されるはずである。とくに、  $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ 構造にともなって新たに現れた分数次 スポットの強度には、バルクの位置を占める基板 Si原子層からの寄与は含まれないので、この効果 を調べるのに都合がよい。

図10<sup>16)</sup>は、(2/3 2/3)スポット強度を波長を 変えながら測定した結果である。波長が変わると Ag 原子層と変位したSi 原子層で回折した波の干 渉の仕方が異なり、回折強度は振動成分をもつよ うになる。その振動の周期は、2つの層の間隔に 反比例する。

図に見られるおもな振動の周期は, Ag の約3 A下のSi2重層がバルクの位置からかなりずれて いることを示している。また,振動成分を平均し た回折強度の値から判断すると, Ag 原子層の下 約0.9Aの位置にSi 原子層存在する可能性が極め て高い。Ag 原子がSi 原子とどのように結合して いるかは,今のところ推測のいきを脱していない。

原理的には、このような表面付近のSi原子の位 置は、X線回折法のデータのみから決定可能であ り、それがX線回折法の特徴の1つでもある。し かし、現状では、測定精度に問題があり、まだ、 全ての原子配列を決定するには至っていない。そ れは、本稿で述べた実験は、高エネルギー研放射 光施設のBL-10Cで行われたが、回折強度は、

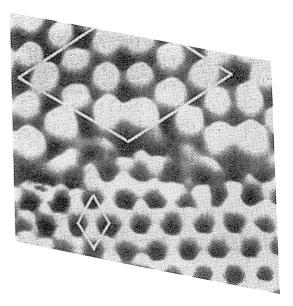


Fig.11.<sup>15)</sup> STM image, with contrast enhancement, of a Si(111) 7 × 7 to Si(111)  $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ -Ag domain boundary, recorded with a positive sample bias 2 V.

毎秒1カウント程度であり、図8あるいは図10の 曲線を測定するだけでも数日のオーダーで時間を 費やさねばならなず、まだ十分精度の高い実験と は言い難いからである。

#### 3.4 表面の第1層はAgか,Siか

Ag の $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ 構造は、すでに述べたように 長い間未解決であるが、その1つの論点は、表面 第1層は、Ag 原子かSi 原子かということである。 このようなことは、イオン散乱法、STMが得意と するところであるが、Ag の $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ 構造の場 合に限って言えば、議論が割れている。

Ag 原子は, Si 原子の下に埋もれているという 最初の報告<sup>4)</sup>がイオン散乱法によりなされた。そ の後いくつかのイオン散乱のグループも同様な測 定を行ったが、グループにより異なる結果を出し ている。STMでも事情は同じで、最初に述べた ように, IBMの2つのグループで異なる結果を報 告している。

3.3 の問題と関係していて,現在のX線回 折データのみから直接的に決定するのは少し無理 があるが,以下の議論から,我々は,表面第1層 はAg原子であると解釈している。

我々のモデルは、Ag-Agの距離は、約3.4Aで ある。これは、Agのvan der Waals距離に一致 している。このことから、Ag原子層の上に更にSi 原子層が存在するのは、結合の観点から考えにく い。我々のモデルで、三角形の中心の真上にSi をおけば、ハニカム状に配列する(見やすくする ために、図7で6つの三角形に斜線を入れた)。 このようなモデルに対して、我々の実験データを 解析しても、一致の度合は改善されなかった。

そこで、我々は、STM像はなんらかの理由で、 三角形状のAg 原子を1体としてとらえていると 解釈することにした。実際、図11<sup>15)</sup>のように、 試料にかけるバイアスを変えたときには、我々の モデルを想像させるような連なったハニカム構造 が観測されている(図の下の部分)。また、図11 のSTM像の上の部分では、Si(111)清浄表面の7× 7構造に対応する像が観測されている。7×7構 造の原子配列<sup>19)</sup>は良く分かっているので、それ を基準にして、 $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ 構造のハニカム状に見 えている位置をSi 結晶に対してもとめることが できる。このようにして求めたハニカム状の位置 は、我々が回折法で求めた図9の吸着位置にまさ に対応している。

### 4. おわりに

我々の提唱したHCTモデルは、その後、電子 回折法、イオン散乱法のデータとも大きく矛盾す ることはないことが確かめられ、さらに、最近、 微小角入射X線回折法<sup>20)</sup>でも、我々とほぼ同じ Ag の原子配列が求められた。表面第1層を占め る原子についても、最近の新しいイオン散乱<sup>21)</sup> の結果では、Ag 原子が占めているという結果が 得られている。

以上述べたように,まだ全体像は明らかにはさ れないが,Agの原子配列については,ほぼ収束 に向かっているように思われる。しかし,一方で は,表面構造の対称性が崩れていてドメイン構造 をもつという可能性も残されており、まだしばら くの間は、ホットな論争が続きそうである。(も し、今より1000倍程度強いX線が得られれば、こ れら全ての問題は、直ちに解決するのだが)

本研究の実験にあたっては、高エネルギー研の 松下正、小林克己両氏を始めとして,多くの方々に 協力して頂き感謝致します。

### 参考文献

- 1) K.Spiegel: Surf. Sci. 7 (1967) 125.
  - Y. Gotoh and S. Ino: Jpn. J. Appl. Phys. 17 (1978) 2097.
  - F. Wehking, H.Beckermann and R. Niedermayer: Surf. Sci. 71 (1978) 364.
  - 4) M. Saitoh, F. Shoji, K. Oura and T. Hanawa: Jpn.J. Appl. Phys. 19 (1980) L421.
  - 5) Y. Gotoh, A. Chauvet, M. Manneville and R. Kern: Jpn. J. Appl. Phys. 20 (1981) L853.
  - 6) Y.Terada, T.Yoshizuka, K.Oura and T.Hanawa: Surf. Sci. 114 (1982) 65.
- 7) J.Stohr, R.Jaeger, G.Rossi, T.Kendelewics and I. Lindau: Surf. Sci.134 (1983) 813.
- Y.Horio and A.Ichimiya:Surf. Sci. 133 (1983) 393.
- 9 ) Y.Horio and A.Ichimiya:Surf. Sci. 164 (1985)
  589.
- S.Kono, K.Higashiyama and T.Sagawa: Surf. Sci. 165 (1986) 21.
- M.Aono, R.Souda, C.Oshima and Y.Ishizawa: Surf. Sci. 168 (1986) 713.
- 12) S.Hasegawa, H.Daimon and S.Ino: Surf. Sci.138 (1987) 138.
- 13) E.J.van Loenen, J.E.Demuth, R.M.Tromp, and R. J. Hamers: Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 373.
- 14) R.J.Wilson and S.Chiang:Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 369.

- R.J.Wilson and S.Chiang:Phys. Rev. Lett. 59 (1987) 2329.
- T.Takahashi, S.Nakatani, N.Okamoto, T.Ishikawa and S. Kikuta: Jpn. J.Appl Phys. 27 (1988) L 753.
- 17) T.Takahashi, S.Nakatani, N.Okamoto, T.Ishikawa and S. Kikuta: Rev. Sci. Instrum., in press.
- T.Takahashi, S.Nakatani, T.Ishikawa and S. Kikuta: Surf. Sci. 191 (1987) L827.
- K.Takayanagi, Y.Tanishiro, S.Takahashi and M.Takahashi: Surf. Sci. 164 (1985) 367.
- 20) E.Vlieg, A.W.Denier van der Gon, J.F. van der Veen, J.E.MacDonald and C.Norris: Surf. Sci. 209 (1989) 100.
- 21) Shown by K.Sumitomo, K.Tanaka, Y.Izawa, I.Katayama, F.Shoji, k. Oura and T.Hanawa (HP-4), and allso by M.Katayama, T.Cassse, M.Kato and M. Aono at the 2 nd International Conference on Formation of Semiconductor Interfaces,(Takarazuka,1988)